1550 nm低损耗单模全固态光子带隙光纤研究*

程兰 罗兴 韦会峰 李海清 彭景刚 戴能利 李进延*

(武汉光电国家实验室,武汉 430074)

(2013年10月10日收到; 2013年11月26日收到修改稿)

全固态光子带隙光纤由于其独特的带隙和色散特性以及易于和传统光纤熔接的优势,引起了国内外研 究人员的广泛关注.本文采用等离子体化学气相沉积工艺结合堆叠拉制法制备了全固态光子带隙光纤,并运 用频域有限差分法模拟了其损耗和色散特性.该光纤1550 nm 处有较低损耗且单模传输,计算得到1550 nm 处的有效模场面积和色散分别为191.81 µm²和16.418 ps/(km·nm),在测试范围1500—1650 nm 内损耗小于 0.15 dB/m.结合实验结果,对光纤参数做了进一步模拟优化.

关键词: 全固态光子带隙光纤, 光子带隙, 损耗 PACS: 42.70.Qs, 42.81.Cn, 42.81.Dp

DOI: 10.7498/aps.63.074210

1引言

全固态光子带隙光纤^[1](all-solid photonic bandgap fibers, ASPBFs)以其独特的光学和结构 特点成为研究热点.典型的全固态光子带隙光纤 由高折射率棒嵌入到均匀背景材料中构成,纤芯为 周期结构中心缺陷^[2].由于其不含空气孔或存在 少量空气孔,具有容易拉制并进行结构参数精确 控制的特点.相比空芯光子带隙光纤^[3],ASPBFs 避免了表面模^[4]的存在、易于与传统光纤熔接、容 易实现增益掺杂.目前ASPBFs已用于激光器、 放大器^[5-8]以及光纤光栅^[9-13]等领域中.利用 ASPBFs特有的带隙和带隙内色散特性,可根据 实际应用需要产生特定波长范围内的超连续谱输 出^[14-16].

早期对全固态光子带隙光纤的研究显示,虽然 高阶带隙相对于低阶带隙有较低的限制性损耗,但 高阶带隙弯曲损耗比较大,对变形比较敏感,窄化 传输窗口^[17].由于低阶带隙具有相对较大的带隙 宽度,因此设计具有低的限制性损耗和弯曲损耗且 工作在低阶带隙的全固态光子带隙光纤具有极大

的研究意义.

本文制备了第一带隙中心在1600 nm的全固 带隙光纤,从模拟计算和实验测试两方面研究了 光纤的性能.结合工艺的可行性,通过理论模拟对 光纤参数进行了优化,为1550 nm低损耗、宽带宽 单模全固态光子带隙光纤制备提供了实验和理论 依据.

2 光纤的制备与性能

采用等离子体化学气相沉积工艺(Plasma Chemistry Vapor Deposition)制备高掺锗预制棒. 折射率分布如图1,其折射率分布为渐变型,掺杂 区相对纯硅背景的最大折射率差为0.0367,掺杂区 直径与整个预制棒直径的比值为0.34.在拉丝塔上 拉成1mm左右的毛细玻璃棒^[18],将毛细玻璃棒堆 积成六边形,中心棒用纯二氧化硅玻璃棒代替,之 后套上套管在拉丝塔上拉丝、涂覆得到ASPBF^[19].

图 2 为光纤的电子显微镜图,光纤包层由五层 高折射率棒组成,外径为125 μm,在光纤拉制过 程中高折射棒直径与高折射率棒之间间距的比值 *d*/*Λ* 与掺杂预制棒的占空比近似保持不变,即为

^{*} 国家自然科学基金(批准号: 81100701)资助的课题.

[†]通讯作者. E-mail: ljy@mail.hust.edu.cn

^{© 2014} 中国物理学会 Chinese Physical Society

0.34,从电子显微镜图读出高折射率棒之间的间距 *Λ*为8.87 μm,与预计的尺寸基本一致.



图1 预制棒折射率剖面



图 2 ASPBF 的电镜扫描图

2.1 光纤特性模拟

利用频域有限差分^[20,21] (finite-difference frequency-domain, FDFD)法结合完美匹配层^[22] (perfectly matched layer, PML)边界对光纤进行 模拟.取背景折射率1.457,为了简化计算用阶跃 折射率剖面代替渐变折射率剖面,掺杂区与背景材 料的折射率差 Δn 取2.4%,其他参数与制备的光纤 一致,计算得到光纤的复有效折射率和光纤的模场 图.依据复有效折射率的实部 ($n_{effcore}$)与波导色散 的关系为

$$D_{\rm w} = -\frac{\lambda}{c} \times \frac{\partial^2 n_{\rm effcore}}{\partial^2 \lambda},\tag{1}$$

可以计算出波导色散,将光子晶体光纤的总色散 D 写成材料色散 D_m和波导色散 D_w两部分^[23]:

$$D = D_{\rm w} + D_{\rm m}.\tag{2}$$

对于熔石英光子晶体光纤而言,材料色散 $D_{\rm m}$ 由 Sellmeier公式^[24]来求,即通过(2)式可以求出光纤 的总色散.依据复有效折射率虚部 $(n_{\rm effcore}^i)$ 与限制 损耗(CL)的关系^[25]为

$$=\frac{2 \times \pi \times 8.686 \times 1000 \times n_{\text{effcore}}^{i}}{\lambda}, \qquad (3)$$

可以计算出限制损耗, (3) 式中λ的单位是 m.

全固态光子带隙光纤的导光机理一般用反 谐振反射式光波导 (anti-resonant reflecting optical waveguide, ARROW) 模型^[26] 来解释. 该模型表 明: 当在某一波长处包层高折射率棒支持新的模 式, 在该波长处光纤有较大的传输损耗. 因此可以 通过计算光纤中高折射率棒的截止波长近似计算 全固态光子带隙光纤的带隙位置, 计算得到本文 中光纤包层高折射棒线偏振 LP 模式截止波长^[2] 如 表1. 从表1可以看出前三个带隙波长范围分别为 [1293 nm; ∞], [790 nm; 1293 nm] 和[590 nm; 750 nm].

表1 高折射率棒截止模式(l和m分别为角向和径向模式标号)

模式 <i>l</i> , m	模群 $2m+l$	截止波长/nm
0, 1	2	∞
1,1	3	1293
0, 2	4	790
2, 1	4	750
3, 1	5	590





模拟前三个带隙的特性发现第一带隙和第二 带隙只能限制住基模HE₁₁,第三带隙除了限制住 基模以外还可以限制二次模.光纤基模的限制损 耗如图3中黑线所示,前三个带隙的低损耗峰分别 在 1630, 1020 和 660 nm 附近, 1296 和 790 nm 附近 第一、二带隙截止, 该结果与利用反谐振反射式光 波导模型近似计算的带隙边界一致. 1550 nm 处基 模 HE₁₁ 的模场分布如图 3 插图, 虽然有部分光进 入了纤芯周围的六个高折射棒中, 但绝大部分的光 还是被限制在低折射纤芯中, 计算得到其有效模场 面积为191.81 μm². 660 nm 处的二次模的模场分 布和横电场图如图 4 其中 (a), (b), (c), (d) 为模场 图, (e), (f), (g), (h) 分别为 (a), (b), (c), (d) 所对应 的横电场图, 计算得到光纤模式与文献 [27, 28] 中 略有区别, 只能从 (e), (f) 判断出 (a), (b) 分别对应 着 TE₀₁ 模和 HE₂₁ 模, 而从 (g), (h) 不能判断出 (c), (d) 分别为何种模式, 我们猜测原因是模式进行了 重新组合.



图 4 (网刊彩色) 660 nm 处 LP11 模场分布和横电场图 (上排为模式图,下排为上排对应的横电场图)



图 5 (网刊彩色) 色散图 (黑线表示总色散, 红线表示波导色散, 蓝线表示材料色散)

光纤的色散如图 5 所示,在带隙的边缘有效折 射率变化很快,因此在每个带隙的短波边会出现极 大的正常波导色散,而长波边会出现极大的反常波 导色散.石英材料零色散点1.27 μm,靠近第二带 隙的长波边,第一带隙材料色散为反常色散,第三 带隙材料色散为正常色散,加上材料色散使得第一 带隙总色散的零色散点相对于波导色散向短波方 向移动,第二、第三带隙总色散的零色散点相对于 波导色散向长波方向移动.三个带隙总色散的零色 散点分别为735,1074和1494 nm,在1550 nm 处光 纤的总色散为16.418 ps/(km·nm).

2.2 光纤测试

我们使用光子晶体光纤宽带超连续光源,测试 了 ASPBF 的传输谱,测试光纤长度为20 m.为了 去掉高折射率棒中的包层模式,在测试光纤的两端 都熔接了 0.5 m 的单模光纤,输出端通过光谱仪进 行数据采集,光谱仪采集数据的步长为2 nm.将测 试传输谱和模拟的损耗谱进行对比,归一化传输谱 如图 3 蓝线所示,从500 到 2400 nm 波长范围内在 660,1000 和 1600 nm 附近存在有三个明显的传输 带,1600 nm 处的传输带比较宽,直到 1530 nm 还 能保持高效的传输,模拟和测试结果相当符合.

为了进一步研究 1550 nm 附近的传输性能, 采 用截短法测试 100m 光纤的损耗谱如图 6. 在测试 范围 1500—1650 nm 内损耗小于 0.15 dB/m, 损耗 随波长增加呈减小趋势损耗的进一步减小可以通 过改进制作工艺, 如增加酸洗和烘干等工艺, 从而 减少杂质吸收, 在制作预制棒时尽量选取外径一致 的玻璃棒, 以避免光纤结构缺陷带来本征损耗. 在 测试范围 1500—1650 nm, 光纤绕一圈 (弯曲半径 10 mm), 引起的宏弯附加损耗小于 0.1 dB, 和常规 通讯光纤相当, 可见光纤的抗弯曲的性能比较好.



图 6 1550 nm 附近的损耗谱

3 光纤参数优化

ASPBFs带隙的宽带和位置不随高折射率棒 层数的变化而变化,光纤损耗随着层数的增加而减 小^[29].计算得到当高折射棒层数增加到六层和七 层(其他参数与前面的模拟一致)时第一带隙的限 制损耗如图7,对比包层只有五层高折射率棒时的 计算结果,可以看出当包层层数增加时限制损耗显 著减小,当高折射棒层数增加到六层或者七层时, 带隙的低损耗峰附近600 nm的范围内损耗比五层 时的损耗4%和0.24%小.由于增加高折射棒的层 数基本上不会增加制作工艺的难度,采用这种方式 能有效的降低光纤损耗.



图 7 (网刊彩色) 高折射率棒层数不同时的限制损耗

ASPBFs的带隙位置由高折射率棒性质决定, 增加高折射棒的折射率和尺寸都会使带隙红移^[30]. 为了使光纤的带隙中心更接近1550 nm,可以降低 高折射率棒的折射率或者减小高折射棒的尺寸.考 虑到光纤拉丝过程中尺寸的控制比预制棒制作过 程折射率分布的控制要容易,采用了减小高折射棒 的尺寸的方法. 计算得到微调高折射率棒直径时限 制损耗的变化(图8)计算时采用两种材料的折射 率和高折射率棒之间的间距与前面的计算过程一 致,高折射率棒层数取五层,高折率棒直径分别为 3.02, 2.96, 2.90和2.83 µm 其中3.02 µm 是开始计 算光纤特性时的参数. 虽然高折射率棒直径变小会 使光纤的纤芯相对变大,但模拟过程中光纤在第一 带隙始终保持基模传输,可以看出随着高折率棒直 径的减小,低损耗中心移向短波边,低损耗中心的 损耗减小. 当高折射棒直径取2.83 µm时,低损耗 中心在1550 nm.



图 8 (网刊彩色) 高折射率棒直径不同时的限制损耗

4 结 论

本文制作了第一带隙中心在 1600 nm 附近的 全固带隙光纤,模拟计算和实验测试结果都表明该 光纤在 1550 nm 处损耗比较低,在第一带隙该光纤 只能传输基模,1550 nm 处的有效模场面积和色散 分别为 191.81 μm² 和 16.418 ps/(km·nm),模场面 积比通讯单模光纤大,色散相当根据模拟计算结果 对结构参数参数进行优化,增加高折射棒层数到六 层或者七层,其带隙中心损耗分别低于五层的 4% 和 0.24%,当掺杂区与背景材料的折射率差 Δ*n* 为 2.4% 时,为了使光纤第一带隙中心在 1550 nm 处, 高折射率棒的直径应取 2.83 μm.本文的研究结果 对设计和制备不同波长带隙中心的全固态光子带 隙光纤具有重要的参考意义.

感谢长飞光纤光缆公司和西安光机所在相关测试上面 提供的帮助.

参考文献

- Luan F, George A K, Hedley T D, Pearce G J, Bird D M, Knight J C, Russell P S J 2004 Opt. Lett. 29 2369
- [2] Bouwmans G, Bigot L, Quiquempois Y, Lopez F, Provino L, Douay M 2005 Opt. Express 13 8452
- [3] Mi Y, Hou L T, Zhou G Y, Wang K, Chen C, Gao F, Liu B W, Hu M L 2008 Acta Phys. Sin. 57 3583 (in Chinese)[米艳, 侯蓝田, 周桂耀, 王康, 陈超, 高飞, 刘博文, 胡明列 2008 物理学报 57 3583]
- [4] Cheng S F, Peng J G, Li J Y, Cheng L, Jiang Z W, Li H Q, Dai N L, Jiang F G, Yang X B 2012 Acta Phys. Sin. 61 244207 (in Chinese)[程胜飞, 彭景刚, 李进延, 程兰, 蒋作文, 李海清, 戴能利, 姜发刚, 杨晓波 2012 物理学报 61 244207]
- [5] Olausson C B, Shirakawa A, Chen M, LyngsØ J K, Broeng J, Hansen K P, Bjarklev A, Ueda K 2010 Opt. Express 18 16345
- [6] Fan X, Chen M, Shirakawa A, Ueda K, Olausson C B, LyngsØ J K, Broeng J 2012 Opt. Express 20 14471
- [7] Février S, Gaponov D D, Roy P, Likhachev M E, Semjonov S L, Bubnov M M, Dianov E M, Yashkov M Y, Khopin V F, Salganskii M Y 2008 *Opt. Lett.* 33 989
- [8] Liu X, Lægsgaard J, Turchinovich D 2010 Opt. Lett. 35 913
- [9] Jin L, Wang Z, Fang Q, Liu B, Liu Y G, Kai G Y, Dong X Y, Guan B O 2007 Opt. Lett. **32** 2717
- [10] Lee H W, Chiang K S 2009 Opt. Express 17 4533
- [11] Sun Z L, Liu Y G, Wang Z, Tai B Y, Han T T, Liu B, Cui W T, Wei H F, Tong W J 2011 Opt. Express 19 12913
- [12] Jin L, Wang Z, Fang Q, Liu Y G, Liu B, Kai G Y, Dong X Y 2007 Opt. Express 15 15555
- [13] Jin L, Wang Z, Liu Y G, Kai G Y, Dong X Y 2008 Opt. Express 16 21119
- [14] Bétourné A, Kudlinski A, Bouwmans G, Vanvincq O, Mussot A, Quiquempois Y 2009 Opt. Lett. 34 3083

- [15] Kibler B, Martynkien T, Szpulak M, Finot C, Fatome J, Wojcik J, Urbanczyk W, Wabnitz S 2009 Opt. Express 17 10393
- [16] Vanvincq O, Barviau B, Mussot A, Bouwmans G, Quiquempois Y, Kudlinski A 2010 Opt. Express 18 24352
- [17] Ren G B, Shum P, Zhang L R, Yan M, Yu X, Tong W J, Luo J 2006 *IEEE Photonic Tech. L* 18 2560
- [18] Guo T Y, Lou S Q, Li H L, Jian S S 2009 Acta Phys. Sin. 58 4724 (in Chinese)[郭铁英, 娄淑琴, 李宏雷, 简水 生 2009 物理学报 58 4724]
- [19] Guo T Y, Lou S Q, Li H L, Jian S S 2009 Acta Phys. Sin. 58 6038 (in Chinese)[郭铁英, 娄淑琴, 李宏雷, 简水 生 2009 物理学报 58 6038]
- [20] Zhu Z M, Brown T 2002 Opt. Express 10 853
- [21] Guo S P, Wu F, Albin S, Tai H, Rogowski R 2004 Opt. Express 12 3341
- [22] Margengo E A, Rappaport C M, Miller E L 1999 IEEE Trans. Magn. 35 1506
- [23] Ferrando A, Silvestre E, Andres P, Miret J J, Andres M V 2001 Opt. Express 9 687
- $[24]\,$ Malitson I H 1965JOSA 55 1205
- [25] Chen X, Li M J, Koh J, Artuso A, Nolan D A 2007 Opt. Express 15 10629
- [26] Litchinitser N M, Dunn S C, Usner B, Eggleton B J, White T P, Mcphedran R C, de Sterke C M 2003 Opt. Express 11 1243
- [27] Xing W Q, Bai J X, Li Y F 2012 J. Lightwave Technol. 30 821
- [28] Ren G B, Wang Z, Lou S Q, Jian S S 2004 Acta Phys. Sin. 53 1856 (in Chinese)[任国斌, 王智, 娄淑琴, 简水生 2004 物理学报 53 1856]
- [29] White T P, Mcphedran R C, Martijnde Sterke C, Litchinitser N M, Eggleton B J 2002 Opt. Lett. 27 1977
- [30] Tan X L 2009 Ph. D. Dissertation (Tianjin: Tianjin University) (in Chinese) [谭晓玲 2009 博士学位论文 (天津: 天津大学)]

Study of 1550 nm low loss single mode all-solid photonic bandgap fibers *

Cheng Lan Luo Xing Wei Hui-Feng Li Hai-Qing Peng Jing-Gang Dai Neng-Li Li Jin-Yan[†]

(Wuhan National Laboratory for Optoelectronics, Wuhan 430074, China)(Received 10 October 2013; revised manuscript received 26 November 2013)

Abstract

All-solid photonic bandgap fiber shave attracted great attention of researchers due to their particular band gap and dispersion character as well as the merit of easily splicing the traditional optical fiber. We have fabricated the all-solid photonic bandgap fibers using the plasma chemical vapor deposition (PCVD) and a modified tack and draw technique, and the loss and dispersion characteristics were simulated by the finite-difference frequency-domain (FDFD) method. The fiber obtained by this method has a low-loss region at around 1550 nm and can be used as single-mode; its effective model field area and the dispersion of the fiber at 1550 nm are 191.81 μ m² and 16.418 ps/(km·nm), respectively. Combined with the experimental results, the fiber parameters are further optimized by simulation.

Keywords: all-solid photonic bandgap fibers, photonic band gap, loss

PACS: 42.70.Qs, 42.81.Cn, 42.81.Dp

DOI: 10.7498/aps.63.074210

 $[\]ast\,$ Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant No. 81100701).

 $[\]dagger$ Corresponding author. E-mail: <code>ljy@mail.hust.edu.cn</code>